

HOXON[®]

CLEAN SURFACE TECHNOLOGIES

臭氧清洁表面技术



- +晶片清洗
- +无机氧化
- +光阻材料的去除
- +水的消毒
- +生物膜的清除
- +气相沉积法（CVD）的应用





HOXON[®]

臭氧清洁表面技术

德国 Anseros 公司开发的 HOXON 表面清洁技术是半导体工业的新模范。HOXON 系统是基于完全生态环保和保证人身安全的绿色科技。

我们坚信并遵循着大自然的法则，调整 HOXON 系统科技以迎合表面清洁应用的需求

我们在成功建立 HOXON 系统，助力于半导体工业这项事业上，拥有超过二十五年的悠久历史。只要您说出问题，我们已经为您准备了解决方案。我们欢迎您可以与我们的研发人员展开友好的探讨：我们可以为您做些什么。

详细应用请参考以下实例：

- +晶片清洗，UCT-工艺
- +无机氧化
- +光阻材料的去除
- +去离子水的消毒
- +原位生物膜的去除
- +化学气相沉积的应用
- +废水处理



HOXON[®]

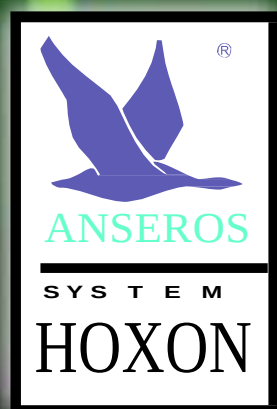
臭氧清洁表面技术

COM-AD-08 臭氧

COM-AD-08 臭氧

臭氧发生器使 HOXON





HOXON[®]

臭氧清洁表面技术



臭氧破坏机 CAT-HO-8000

臭氧破坏机能处理在高流
并作进气和排气的压力控制，
工具不受金属颗粒破坏。拥有
水相臭氧破坏机 CAT-HO-8000
排水，光辐射原理

ANSEROS 德国图宾根总部



分销代理

制造商



ANSEROS KLAUS NONNENMACHER GMBH D-
72070 TÜBINGEN, DISCHINGERWEG 11
PHONE +49 7071-7995-0 FAX +49 7071-7995-
95 info@aneros.de, www.aneros.de